

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第3区分

【発行日】平成19年4月26日(2007.4.26)

【公表番号】特表2006-524309(P2006-524309A)

【公表日】平成18年10月26日(2006.10.26)

【年通号数】公開・登録公報2006-042

【出願番号】特願2006-507005(P2006-507005)

【国際特許分類】

F 26B 21/04 (2006.01)

F 26B 13/02 (2006.01)

F 26B 21/12 (2006.01)

【F I】

F 26B 21/04 A

F 26B 13/02

F 26B 21/12

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月7日(2007.3.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

不特定長さの移動する基材を処理するための装置であつて、

(a) 前記基材の表面に密に近接し、前記基材との間に制御間隙を画定する、制御表面と、

(b) 前記制御表面の近くに位置するとともに気体導入デバイスを有する第1のチャンバと、

(c) 前記制御表面の近くに位置するとともに気体取出しデバイスを有する第2のチャンバとを含み、前記制御表面および前記第1および第2のチャンバが、隣接した気相がある量のマスを有する領域を画定し、前記領域内の前記マスの少なくとも一部が移送されたときに $M_1 + M_1' + M_2 + M_3 = M_4$ を満足し、

ここで、 M_1 は、圧力勾配から生じる、前記領域内へのまたは前記領域からの単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

M_1' は、前記気体導入デバイスから前記第1のチャンバを通る前記領域内への、単位幅あたりの気体の総正味時間平均マスフローを意味し、

M_2 は、前記基材の少なくとも1つの主面からまたは前記基材の少なくとも1つの主面内への、前記領域内への、単位幅あたりの時間平均マスフローを意味し、

M_3 は、前記材料の動きから生じる、前記領域内への単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

M_4 は、単位幅あたりの、前記気体取出しデバイスを通るマス移送の時間平均速度を意味する、装置。

【請求項2】

不特定長さの移動する基材を処理するための方法であつて、

(a) 制御表面を、前記基材と前記制御表面との間に制御間隙を画定するように、前記基材の表面に密に近接して配置する工程と、

(b) 気体導入デバイスを有する第1のチャンバを前記制御表面の近くに位置決めする

工程と、

(c) 気体取出しデバイスを有する第2のチャンバを、前記制御表面および前記第1および第2のチャンバが隣接した気相がある量のマスを有する領域を画定するように、前記制御表面の近くに位置決めする工程と、

(d) 前記領域内の前記マスの少なくとも一部を、 $M_1 + M_1' + M_2 + M_3 = M_4$ を満足するように移送する工程とを含み、

ここで、 M_1 は、圧力勾配から生じる、前記領域内へのまたは前記領域からの単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

M_1' は、前記気体導入デバイスから前記第1のチャンバを通る前記領域内への、単位幅あたりの気体の総正味時間平均マスフローを意味し、

M_2 は、前記基材の少なくとも1つの主面からまたは前記基材の少なくとも1つの主面内への、前記領域内への、単位幅あたりの時間平均マスフローを意味し、

M_3 は、前記材料の動きから生じる、前記領域内への単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

M_4 は、単位幅あたりの、前記気体取出しデバイスを通るマス移送の時間平均速度を意味する、方法。